

# 利用料金一覧表

広島大学ARIM支援

2024.06.06

	区分	支援負担金(円/時間)			
		学外者が支援を受ける場合			
		(C) 自主事業 (非公開利用)	ARIM利用		
(B) データ 非共用	(A) データ 共用				
1	技術相談料	8,580	3,300	3,300	
2	技術代行料	8,580	3,300	3,300	
3	施設使用料				
	クリーンルーム	2,860	1,100	1,100	
	ドラフト	2,860	1,100	1,100	
4	設備使用料				
	機器ID	装置名			
リソグラ フィー	R0-111	超高精度電子ビーム描画装置	33,000	16,500	12,650
	R0-112	マスクレス露光装置	17,160	8,580	6,600
	R0-113	マスクレス露光装置	22,880	11,440	8,800
	R0-121	スピンコータ	5,720	2,860	2,200
	R0-122	プログラム・ホットプレート	5,720	2,860	2,200
	R0-123	インビトロシェーカー	5,720	2,860	2,200
	R0-131	レイアウト設計ツール	8,580	4,290	3,300
	R0-132	MEMS設計ツール(IntelliSuite)	8,580	4,290	3,300
不純物導入 薄膜形成	R0-212	高温イオン注入装置	42,900	21,450	16,500
	R0-221	酸化炉	8,580	4,290	3,300
不純物導入・各種ア ニール	R0-222	Rapid Thermal Anneal装置 (RTA)	8,580	4,290	3,300
	R0-223	インプラ後アニール炉	8,580	4,290	3,300
	R0-224	ウェル拡散炉	8,580	4,290	3,300
	R0-225	ポストメタライゼーションアニール (PMA) 炉	8,580	4,290	3,300
	R0-226	燐拡散炉	8,580	4,290	3,300
	R0-227	汎用熱処理装置	8,580	4,290	3,300
	R0-231	連続発振レーザーアニール装置 (レーザー結晶化装置) 【技術代行専用】	57,200	28,600	22,000
薄膜形成	R0-311	LPCVD装置 (poly-Si用)	17,160	8,580	6,600
	R0-312	LPCVD装置 (SiN用)	17,160	8,580	6,600
	R0-313	LPCVD装置 (SiO2用)	17,160	8,580	6,600
	R0-314	常圧SiO2CVD装置	22,880	11,440	8,800
	R0-315	プラズマCVD(PECVD)装置	22,880	11,440	8,800
	R0-321	スパッタ装置 (Al用)	10,010	5,005	3,850
	R0-322	スパッタ装置 (汎用)	10,010	5,005	3,850
	R0-323	スパッタ装置 (Cu用)	10,010	5,005	3,850
	R0-324	多元スパッタ装置	17,160	8,580	6,600
	R0-331	真空蒸着装置	5,720	2,860	2,200
エッチン グ	R0-411	エッチング装置 (RIE SiO2用)	7,480	3,740	2,860
	R0-412	汎用プラズマ処理装置	5,720	2,860	2,200
	R0-413	エッチング装置 (Si深掘用)	22,880	11,440	8,800
	R0-414	エッチング装置 (ICP Al用)	7,480	3,740	2,860
	R0-415	エッチング装置 (CDE SiN用)	7,480	3,740	2,860
	R0-416	エッチング装置 (レジスト Ashing用)	7,480	3,740	2,860
	R0-417	エッチング装置 (ICP Poly-Siゲート用)	7,480	3,740	2,860
	R0-418	エッチング装置 (汎用)	14,300	7,150	5,500
デバイ ス・薄膜 特性評価 及び観察	R0-511	プローバ	7,480	3,740	2,860
	R0-512	半導体パラメータアナライザ	8,580	4,290	3,300
	R0-513	LCRメータ	5,720	2,860	2,200
	R0-514	インピーダンスアナライザ	5,720	2,860	2,200
	R0-515	ホール効果測定装置	8,580	4,290	3,300
	R0-522	EBSD解析装置 【技術代行専用】	28,600	14,300	11,000
	R0-523	二次イオン質量分析装置	20,020	10,010	7,700
	R0-524	蛍光X線分析装置 (XRF)	8,580	4,290	3,300
	R0-525	X線光電子分光装置 (XPS)	14,300	7,150	5,500
	R0-526	薄膜構造評価X線回折装置 (XRD)	5,720	2,860	2,200
	R0-527	走査電子顕微鏡	8,580	4,290	3,300
	R0-531	分光エリプソメーター	5,720	2,860	2,200
	R0-532	干渉式膜厚計	2,860	1,430	1,100
	R0-533	原子間力顕微鏡	5,720	2,860	2,200
R0-534	表面段差計	5,720	2,860	2,200	
その他	R0-601	ダイサー	8,580	4,290	3,300
	R0-602	PDMS加工装置	8,580	4,290	3,300
	R0-603	3Dプリンタ	11,000	5,500	4,400